

2024 年 6 月 18 日

各 位

J X 金属株式会社

次世代半導体向け CVD・ALD 材料の本格生産に向けた能力増強の決定について

J X 金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、需要が拡大する次世代半導体向け CVD・ALD 材料の本格供給に向け、東邦チタニウム株式会社茅ヶ崎工場の敷地内および当社日立事業所白銀地区への生産設備および開発設備投資を決定しましたのでお知らせいたします。

生成 AI の進化により、データセンターや AI 搭載 IoT デバイスの市場が拡大が続いています。これらの機器に必要とされる高性能半導体には、高集積化を実現するためにさらなる微細化や多層化が求められ、これに伴い CVD・ALD による薄膜形成のニーズが高まっています。当社は 2024 年 2 月に「CVD・ALD 材料事業推進室」を新設し、同材料の早期事業化を目指してまいりました。これまで同組織のもとで、新規高純度 CVD・ALD 材料の量産ラインを構築し、顧客へのサンプル出荷を進め、良好な評価を獲得することができております。このたび、本材料の本格採用により急速な需要拡大が見込まれることから、当社は本材料の生産能力の増強を決定しました。茅ヶ崎工場は 24 年度下期、日立事業所は 25 年度上期を目途に生産設備を導入し稼働を開始する計画です。あわせて当事業の今後の展開に向け、新規プロセス開発や新規材料開発に向けた設備強化を行います。これにより、拡大する顧客需要に対応するとともに、高性能化が加速する半導体の進化を支えてまいります。

今後も当社は、半導体材料・情報通信材料のグローバルリーダーとして、高機能・高性能な先端素材の開発・供給を通して、持続可能な社会の発展と革新に貢献してまいります。

以 上

<参考>

2024 年 1 月 26 日付当社プレスリリース「[組織改正について](#)」